国 日 PATENT OFFICE JAPAN

in 12 min. Dec. 20, 2001 2185-0604P 3043

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application: 2000年12月22日

出願番 Application Number: 特願2000-390710

人 Applicant(s):

住友化学工業株式会社

2001年11月26日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2000-390710

【書類名】

特許願

【整理番号】

P152337

【提出日】

平成12年12月22日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C08K 5/07

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】

福田 加奈子

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】

井山 浩暢

【発明者】

【住所又は居所】

大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住友化学工業

株式会社内

【氏名】

肥後 睦子

【特許出願人】

【識別番号】

000002093

【氏名又は名称】 住友化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】

100093285

【弁理士】

【氏名又は名称】 久保山 隆

【電話番号】

06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】

100094477

【弁理士】

【氏名又は名称】 神野 直美

特2000-390710

【電話番号】 06-6220-3405

【選任した代理人】

【識別番号】 100113000

【弁理士】

【氏名又は名称】 中山 亨

【電話番号】 06-6220-3405

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 010238

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9903380

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ブタジエン重合体成形品の製造法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ブタジエン重合体を一般式(I)

$$R^{2}$$
 R^{1}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{8}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{10}
 R^{10}

〔式中、 R^1 、 R^2 および R^4 はそれぞれ独立に水素原子またはアルキル基を示し、 R^3 は水素原子、アルキル基、アルコキシル基、ヒドロキシル基またはアセチル基を示し、 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、 R^9 および R^{10} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基またはアルケニル基を示す。〕

で示される化合物と共に加熱溶融し成形することを特徴とするブタジエン重合体成形品の製造方法。

【請求項2】

ブタジエン重合体が、ポリブタジエン、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-ブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体または耐衝撃ポリスチレンである請求項1に記載の製造方法。

【請求項3】

一般式(I)で示される化合物の使用量がブタジエン重合体100重量部あたり0.001重量部以上である請求項1に記載の製造方法。

【請求項4】

射出成形法、押出成形法またはブロー成形法により成形する請求項1に記載の 製造方法。

【請求項5】

ブタジエン重合体および前記一般式(I)で示される化合物を含むことを特徴とするブタジエン重合体組成物。

【請求項6】

ブタジエン重合体が、ポリブタジエン、スチレン-ブタジエン共重合体、スチレン-ブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体または耐衝撃ポリスチレンである請求項5に記載のブタジエン重合体組成物。

【請求項7】

一般式(I)で示される化合物の含有量がブタジエン重合体100重量部あたり0.001重量部以上である請求項5に記載のブタジエン重合体組成物。

【請求項8】

ブタジエン重合体に前記一般式(I)で示される化合物を含有させることを特徴とするブタジエン重合体の安定化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、ブタジエン重合体成形品の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

ブタジエンを単量体単位とするブタジエン重合体は、加硫されたエラストマー と同程度の弾性と熱可塑性とを兼ね備えた重合体として広く用いられている。

[0003]

かかるブタジエン重合体を成形してその成形品を製造するには、例えばブタジ エン重合体を加熱し溶融したのち成形する方法が知られている。

[0004]

しかし、ブタジエン重合体は加熱下にゲル化してゲル化物を生ずるという問題があった。かかるゲル化物は成形品の外観不良の原因となるものである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

そこで本発明者は、ブタジエン重合体を加熱溶融してもゲル化物を生ずることなく成形して成形品を製造し得る方法を開発するべく鋭意検討した結果、ブタジエン重合体を一般式(I)

$$R^{2}$$
 R^{1}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{8}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{7}

〔式中、 R^1 、 R^2 および R^4 はそれぞれ独立に水素原子またはアルキル基を示し、 R^3 は水素原子、アルキル基、アルコキシル基、ヒドロキシル基またはアセチル基を示し、 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、 R^9 および R^{10} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、 R^9 および R^{10} はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基またはアルケニル基を示す。〕

で示される化合物(以下、化合物(I)とする。)と共に加熱し溶融すれば、ゲ ル化物が生じないことを見出し、本発明に至った。

[0006]

すなわち本発明は、ブタジエン重合体を化合物(I)と共に加熱溶融し成形することを特徴とするブタジエン重合体成形品の製造方法を提供するものである。

[0007]

【発明の実施の形態】

本発明の製造方法に適用されるブタジエン重合体は、ブタジエンを単量体単位とする重合体であって、ブタジエン単独の重合体であってもよいし、ブタジエンと他の単量体との共重合体であってもよい。かかるブタジエン重合体としては、例えばポリブタジエン、スチレンーブタジエン共重合体、スチレンーブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルーブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体、耐衝撃ポリスチレンなどが挙げられる。かかるブタジエン重合体は、例えば溶液重合法、乳化重合法、塊状重合法などの通常の方法で製造することができる。ブタジエン重合体は、樹脂であってもよいし、ゴムであってもよい。ブタジエン重合体がポリブタジエンである場合には、溶液

重合法により製造されたポリブタジエンゴムであってもよいし、乳化重合法により製造されたポリブタジエンゴムであってもよい。

[0008]

化合物(I)において、 R^1 、 R^2 、 R^4 、 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 におけるアルキル基としては、例えばメチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、n-ブチル基、n-ブチル基、n-ブチル基、n-ブチル基、n-ベンチル基、イソペンチル基、n-ベンチル基、n-ベンチル基、n-ベンチル基、n-ベンチル基などの炭素数 n-6 程度のアルキル基などが挙げられる。

[0009]

[0010]

ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基などの炭素数 $1 \sim 180$ アルキル基などが挙げられる。アルケニル基としては、例えば4-メチルペント-3-エニル基、4, 8, 12-トリメチル-3, 7, 11-トリデカトリエニル基などの炭素数 $2 \sim 180$ アルケニル基などがあげられる。

[0011]

 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 おけるフェニル基としては、例えばフェニル基、o-、m-、p-メチルフェニル、2, 3-ジメチルフェニル、2, 4-ジメチルフェニル、2, 5-ジメチルフェニル、2, 6-ジメチルフェニル、3, 4-ジメチルフェニル、4-t -ブチルフェニル、2-エチルフェニル、2-エチルフェニル、2-ボチルフェニル、2-ボチルフェニル、2-ボチルフェニル、2-ボチルフェニル、2-ボチルフェニル、2-ボチルフェニル、2-ボチルフェニル等があげられる。

[0012]

化合物(I)において R^1 、 R^2 および R^4 はそれぞれ独立に水素原子またはアルキル基を示し、 R^3 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基、アルコキシル基、ヒドロキシル基またはアセチル基を示し、 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 はそれぞれ独立に水素原子、アルキル基またはフェニル基を示し、 R^9 および R^{10} はそれぞれ独立に水素原子アルキル基またはアルケニル基であり、 R^{33} が水素原子またはヒドロキシル基であることが好ましく、さらに好ましくは R^{31} 、 R^{32} 、 R^{34} 、 R^{39} および R^{30} がメチル基であり、 R^{35} 、 R^{36} 、 R^{37} および R^{38} が水素原子であることが好ましい。

[0013]

かかる化合物(I)としては、例えば2,2,5,7,8-ペンタメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,7-テトラメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,7-トリメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,8-トリメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,8-トリメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,5-トリメチル-7-t-ブチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,5-トリメチル-8-t-ブチル-6-ヒドロキシクロマン、2,7,8-テトラメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,7,8-テトラメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,5,8-テトラメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,5,8-テトラメチル-6-ヒドロキシクロマン、2,2,3)

[0014]

2, 2, 4-トリメチルー4-(ヒドロキシフェニル)クロマン、2, 2, 4, 6ーテトラメチルー4ー(3,5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル)クロマ ン、2、3、4ートリメチルー2ーエチルー4ー(3ーノニルー4ーヒドロキシ フェニル) -7-ノニルクロマン、2,2,4-トリメチル-4-(3,5-ジ エチルー4ーヒドロキシフェニル) -6-エチルクロマン、2, 2, 4, 6, 8 ーペンタメチルー4ー(3,5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル)クロマン 、2,2,4ートリエチルー3ーメチルー4ー(4ーヒドロキシフェニル)クロ マン、2, 2, 3-トリメチル-3-(4-ヒドロキシフェニル)クロマン、2 , 2, 3, 6-テトラメチルー3ー (3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニ ル) クロマン、2, 3, 4-トリメチルー2-エチルー3-(3-ノニルー4-ヒドロキシフェニル) -7-ノニルクロマン、2,2,3-トリメチル-3-(3, 5-ジエチルー4-ヒドロキシフェニル)-6-エチルクロマン、2, 2, 3, 6, 8-ペンタメチル-3-(3, 5-ジメチル-4-ヒドロキシフェニル) クロマン、2, 2, 5ートリエチルー3ーメチルー3ー(4ーヒドロキシフェ ニル) クロマン、2, 4, 4, 6ーテトラメチルー2ー(3, 5ージメチルー4 ーヒドロキシフェニル)クロマン、2,4,4ートリエチルー2ー(4ーヒドロ キシフェニル) クロマン、2,3,4-トリメチルー4-エチルー2-(3,5 ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) ー 7 ー / ニルクロマン、2, 4, 4 ート リメチルー2ー (3, 5-ジェチルー4-ヒドロキシフェニル) -6-エチルク ロマン、2, 4, 4, 7, 8-ペンタメチルー2-(3, 5-ジメチルー4-ヒドロキシフェニル) <math>-6-エチルクロマン、2, 2, 5, 7, 8-ペンタメチル クロマンなどが挙げられる。

[0015]

かかる化合物 (I) は、それぞれ単独で用いられてもよいし、2種以上の化合物 (I) を用いてもよい。

化合物(I)の使用量は、ブタジエン重合体100重量部あたり通常は0.001重量部以上である。0.001重量部未満であるとゲル化物の生成を十分に防止できない場合があり、好ましくは0.01重量部以上、さらに好ましくは0.005重量部以上である。また使用量の上限は、ブタジエン重合体を加熱溶融して成形しえるのであれば特に限定されないが、10重量部を超えて使用してもそれに見合う効果が得られないため、経済性の点で実用的には通常10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

[0016]

本発明の製造方法においては、化合物(I)と共にフェノール系酸化防止剤、 リン系酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤などの酸化防止剤を用いてもよい。

[0017]

フェノール系酸化防止剤としては、例えば2,6-ジーt-ブチルー4-メチルフェノール、2,4,6-トリーt-ブチルフェノール、2,6-ジーt-ブチルフェノール、2,6-ジーt-ブチルフェノール、2,6-ジーt-ブチルーt-ブチルーt-ズチルフェノール、2,t- ブチルーt- フェノール、2,t- ブチルーt- フェノール、2,t- ブチルーt- フェノール、2,t- ブチルーt- フェノール、2,t- ブチルフェノール、2,t- ジックロペンチルーt- メチルフェノール、2,t- グボデシルーt- スチルフェノール、2,t- グボデシルフェノール、2,t- グボデシルフェノール、2,t- グボデシルフェノール、2,t- グボデンステルフェノール、2,t- グボデンステルフェノール、2,t- グボデンステルフェノール、2,t- グボデンステルーt- スチルウンデシルー1 t- イル)フェノール、2,t- グボデルーt- スチルウンデシルー1 t- イル)フェノール、2,t- グボデルーt- クー (1 t- スチルヘプタデシルー1 t- イル)フェノール、2

,4-ジメチル-6-(1' -メチルトリデシル-1' -イル)フェノールおよびそれらの混合物などのアルキル化モノフェノール、

[0018]

2, 4-ジオクチルチオメチルー<math>6-t-ブチルフェノール、2, 4-ジオクチルチオメチルー6-メチルフェノール、2, 4-ジオクチルチオメチルー6-エチルフェノール、2, 6-ジドデシルチオメチルー4-ノニルフェノールおよびそれらの混合物などのアルキルチオメチルフェノール、

[0019]

2, 6-ジ-t-ブチル-4-メトキシフェノール、<math>2, 5-ジ-t-ブチルヒドロキノン、<math>2, 6-ジフェニル-4-オクタデシルオキシフェノール、2, 6-ジ-t-ブチルヒドロキノン、<math>2, 5-ジ-t-ブチルヒドロキノン、<math>2, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシアニソール、3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル ステアレート、ビス(3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル アジペートおよびそれらの混合物などのヒドロキノン及びアルキル化ヒドロキノン、

[0020]

[0021]

 ージーtーブチルフェノール)、2,2'ーエチリデンビス(4ーイソブチルー 6-t-ブチルフェノール)、2, 2'-メチレンビス<math>[6-(α-メチルベンメチルベンジル) - 4 - ノニルフェノール]、 4, 4' - メチレンビス (6 - t $- \vec{J} + \vec{J}$ ーブチルフェノール)、4,4'ーブチリデンビス(3-メチルー6-tーブチ ルフェノール)、1,1ービス(4ーヒドロキシフェニル)シクロヘキサン、1 ,1-ビス(5-t-ブチル-4-ヒドロキシ-2-メチルフェニル)ブタン、 2,6-ビス(3-t-ブチル-5-メチル-2-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェノール、1, 1, 3ートリス(5ーt-ブチルー4ーヒドロキシー2 ーメチルフェニル) ブタン、1, 1ービス(5ーtーブチルー4ーヒドロキシー 2ーメチルフェニル)ー3ーnードデシルメルカプトブタン、エチレングリコー ル ビス[3,3ービス-3'-tーブチル-4'-ヒドロキシフェニル)ブチ レート】、ビス(3-t-ブチル-4-ヒドロキシ-5-メチルフェニル)ジシ クロペンタジエン、ビス[2-(3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-メチルベンジル)ー6ーtーブチルー4ーメチルフェニル]テレフタレート、1 , 1ービス(3, 5ージメチルー2ーヒドロキシフェニル)ブタン、2, 2ービ ス(3,5ージーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル)プロパン、2,2ービ ス (5-t-ブチルー4-ヒドロキシー2-メチルフェニル) -4-n-ドデシ ルメルカプトブタン、1, 1, 5, 5ーテトラ(5-t-ブチルー4ーヒドロキ シー2-メチルフェニル)ペンタン、2-t-ブチルー6-(3'-t-ブチル -5'-メチル-2'-ヒドロキシベンジル)-4-メチルフェニル アクリレ ート、2, 4ージーtーペンチルー6ー [1ー(2ーヒドロキシー3, 5ージー tーペンチルフェニル) エチル] フェニル アクリレートおよびそれらの混合物 などのアルキリデンビスフェノールおよびその誘導体、

[0022]

3, 5, 3', 5'ーテトラーtーブチルー4, 4'ージヒドロキシジベンジルエーテル、オクタデシルー4ーヒドロキシー3, 5ージメチルベンジルメルカプ

トアセテート、トリス(3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)アミン、ビス(<math>4-t-ブチル-3-ヒドロキシ-2, 6-ジメチルベンジル)ジチオテレフタレート、ビス(3, <math>5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)スルフィド、イソオクチル-3, <math>5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジルメルカプトアセテートおよびそれらの混合物などの<math>O-ベンジル誘導体、N-ベンジル誘導体および<math>S-ベンジル誘導体、

[0023]

ジオクタデシル 2, 2 ー ビス (3, 5 ー ジー t ー ブチルー 2 ー ヒドロキシベンジル) マロネート、ジオクタデシル 2 ー (3 ー t ー ブチルー 4 ー ヒドロキシー 5 ー メチルベンジル) マロネート、ジドデシルメルカプトエチルー 2, 2 ー ビス (3, 5 ー ジー t ー ブチルー 4 ー ヒドロキシベンジル) マロネート、ビス [4 ー (1, 1, 3, 3 ー テトラメチルブチル) フェニル] ー 2, 2 ー ビス (3, 5 ー ジー t ー ブチルー 4 ー ヒドロキシベンジル) マロネートおよびそれらの混合物などのヒドロキシベンジル化マロネート誘導体、

[0024]

1, 3, 5-トリメチル-2, 4, 6-トリス(3, 5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)ベンゼン、1, 4-ビス(3, 5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)-2, 3, 5, 6-テトラメチルベンゼン、2, 4, 6-トリス(3, 5-t-ブチル-4-ヒドロキシベンジル)フェノールおよびそれらの混合物などの芳香族ヒドロキシベンジル誘導体、

[0025]

 ト、2,4,6ートリス(3,5ージー tーブチルー4ーヒドロキシフェニルエチル)ー1,3,5ートリアジン、2,4,6ートリス(3,5ージー tーブチルー4ーヒドロキシフェニルプロピル)ー1,3,5ートリアジン、トリス(3,5ージシクロヘキシルー4ーヒドロキシベンジル)イソシアヌレート、トリス [2-(3',5'-ジーt-ブチルー4'ーヒドロキシシンナモイルオキシ)エチル]イソシアヌレートおよびそれらの混合物などのトリアジン誘導体、

[0026]

ジメチルー3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホネート、ジエチルー3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシルー3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホネート、ジオクタデシルー5-t-ブチルー4-ヒドロキシー3-メチルベンジルホスホネート、3,5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシベンジルホスホン酸モノエステルのカルシウム塩およびそれらの混合物などのベンジルホスホネート誘導体

[0027]

4-ヒドロキシラウリル酸アニリド、4-ヒドロキシステアリン酸アニリド、オクチル-N-(3,5-ジーt-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)カルバネートおよびそれらの混合物などのアシルアミノフェノール誘導体、

[0028]

 β - (3,5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸と メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、エチレングリコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジオール、1,9-ノナンジオール、ネオペンチルグリコール、ジエチレングリコール、チオエチレングリコール、スピログリコール、トリエチレングリコール、ペンタエリスリトール、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレート、<math>N,N-ビス(ヒドロキシエチル)オキサミド、3-チアウンデカノール、3-チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、4-ヒドロキシメチル-1-ホスファー2,6,7-トリオキサビシクロ[2,2,2]オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコー

ルとのエステル、

[0029]

[0030]

[0031]

3,5-ジーtーブチルー4ーヒドロキシフェニル酢酸と メタノール、エタノール、オクタノール、オクタデカノール、エチレングリコール、1,3-プロパンジオール、1,4-ブタンジオール、1,6-ヘキサンジ オール、1, 9-/ナンジオール、ネオペンチルグリコール、ジエチレングリコール、チオエチレングリコール、スピログリコール、トリエチレングリコール、ペンタエリスリトール、トリス(ヒドロキシエチル)イソシアヌレート、N, N ・ -ビス(ヒドロキシエチル)オキサミド、3-チアウンデカノール、3-チアペンタデカノール、トリメチルヘキサンジオール、トリメチロールプロパン、4-ヒドロキシメチルー1-ホスファー2, 6, 7-トリオキサビシクロ [2, 2] オクタンおよびそれらの混合物などの一価アルコールまたは多価アルコールとのエステル、

[0032]

N, N' -ビス [3-(3',5'-)ジー t-ブチルー4' -ヒドロキシフェニル)プロピオニル] ヒドラジン、N, N' -ビス [3-(3',5'-)ジー t-ブチルー4' -ヒドロキシフェニル)プロピオニル] ヘキサメチレンジアミン、N, N' -ビス [3-(3',5'-)ジー t-ブチルー4' -ヒドロキシフェニル)プロピオニル] トリメチレンジアミンおよびそれらの混合物などの β -(3、5-ジーt-ブチルー4-ヒドロキシフェニル)プロピオン酸のアミドなどが挙げられる。かかるフェノール系酸化防止剤それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0033]

リン系酸化防止剤としては、例えばトリフェニルホスファイト、トリス(ノニルフェニル)ホスファイト、トリス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ホスファイト、トリラウリルホスファイト、トリオクタデシルホスファイト、ジステアリル ペンタエリスリトール ジホスファイト、ジイソデシル ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ペンタエリスリスリトール ジホスファイト、ビス(2,4-ジーt-ブチルー6-メチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス(2,6-ジーt-ブチルー4-メチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ビス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、ドス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ペンタエリスリトール ジホスファイト、トリステアリルソルビトールトリホスファイト、テトラキス(2,4-ジーt-ブチルフェニル)ー4,4-ジフェニレンジホスホナイト、2,2-

ビス(4, 6-ジーt-ブチルフェニル) 2-エチルヘキシル ホスファイト、 2, 2' -エチリデンビス(4, 6-ジーt-ブチルフェニル) フルオロ ホスファイト、ビス(2, 4-ジーt-ブチルー6-メチルフェニル) エチルホスファイト、ビス(2, 4-ジーt-ブチルー6-メチルフェニル) メチルホスファイト、2-(2, 4, 6-トリーt-ブチルフェニル) -5-エチルー 5-ブチルー 1, 3, 2-オキサホスホリナン、2, 2', 2'' -ニトリロ [トリエチルートリス(3, 3', 5, 5' -テトラーt-ブチルー 1, 1' -ビフェニルー 2, 2' -ジイル) ホスファイトおよびそれらの混合物などが挙げられる。かかるリン系酸化防止剤はそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0034]

イオウ系酸化防止剤としては、例えばジラウリル 3,3'ーチオジプロピオネート、トリデシル 3,3'ーチオジプロピオネート、ジミリスチル 3,3'ーチオジプロピオネート、ジステアリル 3,3'ーチオジプロピオネート、ラウリル ステアリル 3,3'ーチオジプロピオネート、ネオペンタンテトライルテトラキス(3ーラウリルチオプロピオネート)などが挙げられる。かかるイオウ系酸化防止剤は、それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0035]

かかる酸化防止剤を使用する場合、その使用量はブタジエン重合体100重量 部あたり通常0.001重量部以上であり、経済性の点で通常10重量部以下で ある。

[0036]

本発明の製造方法においては、紫外線吸収剤、光安定剤、ヒドロキシアミン、 金属不活性剤、滑剤、金属石鹸、造核剤、帯電防止剤、難燃剤、顔料、染料など の着色剤、充填剤などの添加剤と共にブタジエン重合体を加熱溶融してもよい。

[0037]

紫外線吸収剤としては、例えばフェニル サリシレート、4-t-ブチルフェニル サリシレート、2, 4-ジ-t-ブチルフェニル 3', 5'-ジ-tブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、4ーtーオクチルフェニル サリシレート、ビス(4ーtーブチルベンゾイル)レゾルシノール、ベンゾイルレゾルシノール、ヘシサデシル 3', 5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、オクタデシル 3', 5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエート、2ーメチルー4, 6ージーtーブチルフェニル 3', 5'ージーtーブチルー4'ーヒドロキシベンゾエートおよびそれらの混合物などのサリシレート誘導体、

[0038]

2, 4 - ジヒドロキシベンゾフェノン、2 - ヒドロキシー4 - メトキシベンゾフェノン、2 - ヒドロキシー4 - オクトキシベンゾフェノン、2, 2' - ジヒドロキシー4 - メトキシベンゾフェノン、ビス(5 - ベンゾイルー4 - ヒドロキシー2 - メトキシフェニル)メタン、2, 2', 4, 4' - テトラヒドロキシベンゾフェノンおよびそれらの混合物などの2 - ヒドロキシベンゾフェノン誘導体、

[0039]

2-(2-EFiD+2)-5-y+NDy-LN) ベンゾトリアゾール、2-(3), 5'-S-t-J+N-2' - EFiD+2 DT-LN) ベンゾトリアゾール、2-(5'-t-J+N-2'-EFiD+2) JT-LN) ベンゾトリアゾール、2-(2'-EFiD+2)-5'-t-J+N JT-LN) ベンゾトリアゾール、2-(3-t-J+N-2-EFiD+2)-5-J+N JL+DJ+N JL+DJ+N JL+DJ+N JL+DJ+N JL+DJ+N JL+DJ+N JL+DJ+DJ+N $\text{J}\text{L}+\text{D}\text{J}+\text{D}\text{$

ル)フェニル] -5-クロロベンゾトリアゾール、2-[3'-t-ブチル-2 'ーヒドロキシー5'ー (2ーメトキシカルボニルエチル) フェニル] ベンゾト リアゾール、2-[3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5-(2-オクチル オキシカルボニルエチル)フェニル]ベンゾトリアゾール、2-[3'-t-ブ チルー2'ーヒドロキシー5'ー[2-(2-エチルヘキシルオキシ)カルボニ ルエチル] フェニル] ベンゾトリアゾール、2-[2-ヒドロキシ-3-(3, 4, 5, 6-テトラヒドロフタルイミドメチル) -5-メチルフェニル] ベンゾ トリアゾール、2-(3,5-ジーt-ブチル-2-ヒドロキシフェニル)-5 -クロロベンゾトリアゾール、2-(3'-ドデシル-2'-ヒドロキシ-5' -メチルフェニル) ベンゾトリアゾールおよび2-[3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシー5'ー(2ーイソオクチルオキシカルボニルエチル)フェニル] ベ ンゾトリアゾールの混合物、2,2'ーメチレンビス[6-(2H-ベンゾトリ アゾールー2ーイル) -4- (1, 1, 3, 3-テトラメチルブチル) フェノー ル、2, 2'ーメチレンビス[4-t-ブチルー6-(2H-ベンゾトリアゾー ルー2ーイル)フェノール]、ポリ(3~11) (エチレングリコール)と2-[3'-t-ブチル-2'-ヒドロキシ-5'-(2-メトキシカルボニルエチ ル)フェニル] ベンゾトリアゾールとの縮合物、ポリ($3 \sim 1 \ 1$)(エチレング リコール) とメチル 3-[3-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-5 - t - ブチル-4-ヒドロキシフェニル]プロピオネートとの縮合物、2-エチ ルヘキシル 3-[3-t-ブチル-5-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾ ールー2ーイル) -4-ヒドロキシフェニル] プロピオネート、オクチル 3-[3-t-ブチルー5-(5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾールー2-イル) -4-ヒドロキシフェニル]プロピオネート、メチル 3-[3-t-ブチルー 5- (5-クロロ-2H-ベンゾトリアゾール-2-イル) -4-ヒドロキシフ ェニル] プロピオネート、3-[3-t-ブチル-5-(5-クロロ-2H-ベ ンゾトリアゾール-2-イル)-4-ヒドロキシフェニル]プロピオン酸および それらの混合物などの2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾトリアゾールな どが挙げられる。かかる紫外線吸収剤はそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合 わせて用いられる。

[0040]

光安定剤としては、例えばビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリ ジル) セバケート、ビス((2,2,6,6-テトラメチルー4ーピペリジル スクシネート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4ーピペリジル セバケート、ビス (N-オクトキシ-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) セバケート、ビス (N-ベンジルオキシ-2, 2, 6, 6-テト ラメチル-4-ピペリジル)セバケート、ビス(N-シクロヘキシルオキシ-2 , 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル) セバケート、ビス(1, 2, 2 , 6, 6-ペンタメチルー4-ピペリジル)2-(3, 5-ジーt-ブチルー4 -ヒドロキシベンジル)-2-ブチルマロネート、ビス(1-アクロイル-2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) 2, 2-ビス(3, 5-ジ-t ーブチルー4ーヒドロキシベンジル)ー2ーブチルマロネート、ビス(1, 2, 2, 6, 6-ペンタメチルー4ーピペリジルデカンジオエート、2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーピペリジル メタクリレート、4ー[3-(3,5-ジー t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシ]-1-[2-(3 - (3, 5-ジ-t-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオニルオキシ) エチル] -2, 2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、2-メチル-2-(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) アミノーN-(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4ーピペリジル)プロピオンアミド、テトラキス(2,2,6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル)1,2,3,4-ブタンテトラカルボキシ レート、テトラキス(1,2,2,6,6-ペンタメチルー4ーピペリジル) 1, 2, 3, 4-ブタンテトラカルボキシレート、1, 2, 3, 4-ブタンテト ラカルボン酸と1,2,2,6,6-ペンタメチルー4-ピペリジノールおよび 1-トリデカノールとの混合エステル化物、

[0041]

4, 8, 10-テトラオキサスピロ[5・5]ウンデカンとの混合エステル化物 、1、2、3、4-ブタンテトラカルボン酸と2、2、6、6-テトラメチルー 4-ピペリジノールおよび3,9-ビス(2-ヒドロキシー1,1-ジメチルエ エステル化物、ジメチルサクシネートと1-(2-ヒドロキシエチル)-4-ヒ ドロキシー2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジンとの重縮合物、ポリ[(6 -モルホリノ-1, 3, 5-トリアジン-2, 4-ジイル) ((2, 2, 6, 6 ーテトラメチルー4ーピペリジル)イミノ) ヘキサメチレン ((2, 2, 6, 6 -テトラメチル-4-ピペリジル) イミノ)]、ポリ[(6-(1, 1, 3, 3) ーテトラメチルブチル)イミノー1,3,5ートリアジンー2,4ージイル((2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) イミノ) ヘキサメチレン ((2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) イミノ)]、N, N'-ビス (2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル) ヘキサメチレンジアミンと 1, 2-ジブロモエタンとの重縮合物、N, N', 4, 7-テトラキス [4, 6 ービス (N-ブチル-N-(2, 2, 6, 6-テトラメチル-4-ピペリジル) 10ジアミン、N, N', 4-トリス[4,6-ビス(N-ブチル-N-(2, 2, 6, 6-テトラメチルー4-ピペリジル) アミノ) -1, 3, 5-トリアジ ン-2-4ル] -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミン、N, N, 4, 7-テトラキス [4, 6-ビス (N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6-ペン タメチルー4ーピペリジル) アミノ) -1, 3,5-トリアジン-2-イル] -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミン、N, N', 4-トリス[4, 6-ビス (N-ブチル-N-(1, 2, 2, 6, 6 – ペンタメチル-4 – ピペリジル) アミノ) -1, 3, 5-トリアジン-2-イル] -4, 7-ジアザデカン-1, 10-ジアミンおよびそれらの混合物などのヒンダードアミン系光安定剤、

[0042]

 ーシアノー β ーメチルーpーメトキシシンナメート、メチル α ーカルボメトキシーpーメトキシシンナメートおよびNー(β ーカルボメトキシー β ーシアノビニル)ー 2ーメチルインドリンおよびそれらの混合物などのアクリレート系光安定剤、

[0043]

2, 2'ーチオビスー [4ー(1, 1, 3, 3ーテトラメチルブチル) フェノール] のニッケル錯体、ニッケルジブチルジチオカルバメート、モノアルキルエステルのニッケル塩、ケトキシムのニッケル錯体およびそれらの混合物などのニッケル系光安定剤、

[0044]

4, 4' -ジオクチルオキシオキサニリド、2, 2' -ジエトキシオキサニリド、2, 2' -ジオクチルオキシー5, 5' -ジーt-ブチルアニリド、2, 2' -ジドデシルオキシー5, 5' -ジーt-ブチルアニリド、2-エトキシー2' -エチルオキサニリド、N, N' -ビス(3-ジメチルアミノプロピル)オキサミド、2-エトキシー5-t-ブチルー2' -エトキシアニリド、2-エトキシー5, 4' -ジーt-ブチルー2' -エチルオキサニリドおよびそれらの混合物などのオキサミド系光安定剤、

[0045]

2, 4, 6-\lambda

5ートリアジン、2ー [2ーヒドロキシー4ー(2ーヒドロキシー3ーオクチルオキシプロポキシ)フェニル] ー4,6ービス(2,4ージメチルフェニル)ー1,3,5ートリアジンおよびそれらの混合物などの2ー(2ーヒドロキシフェニル)ー1,3,5ートリアジン系光安定剤などが挙げられる。これらの光安定剤は、それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0046]

ヒドロキシアミンとしては、例えばN, Nージベンジルヒドロキシアミン、N, Nージエチルヒドロキシアミン、N, Nージオクチルヒドロキシアミン、N, Nージラウリルヒドロキシアミン、N, Nージテトラデシルヒドロキシアミン、N, Nージへキサデシルヒドロキシアミン、N, Nージオクタデシルヒドロキシアミン、NーへキサデシルーNーオクタデシルヒドロキシアミン、NーへプタデシルーNーオクタデシルヒドロキシアミンおよびそれらの混合物などが挙げられる。かかるヒドロキシアミンはそれぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0047]

金属不活性化剤としては、例えばN, N'ージフェニルオキサミド、NーサリチラルーN'ーサリチロイルヒドラジン、N, N'ービス(サリチロイル)ヒドラジン、N, N'ービス(3, 5ージーtーブチルー4ーヒドロキシフェニルプロピオニル)ヒドラジン、3ーサリチロイルアミノー1, 2, 4ートリアゾール、ビス(ベンジリデン)オキサリルジヒドラジド、オキサニリド、イソフタロイルジヒドラジド、セバコイルビスフェニルヒドラジド、N, N'ービス(サリチロイル)オキサリルジヒドラジド、N, N'ービス(サリチロイル)オキサリルジヒドラジド、N, N'ービス(サリチロイル)チオプロピオニルジヒドラジドおよびそれらの混合物などが挙げられる。かかる金属不活性剤は、それぞれ単独でまたは2種以上を組み合わせて用いられる。

[0048]

滑剤としては、例えばパラフィン、ワックスなどの脂肪族炭化水素、炭素数 8 ~ 2 2 の高級脂肪族酸、炭素数 8 ~ 2 2 の高級脂肪族酸のアルミニウム塩、カルシウム塩、マグネシウム塩、亜鉛塩などの金属塩、炭素数 8 ~ 2 2 の脂肪族アルコール、ポリグリコール、炭素数 4 ~ 2 2 の高級脂肪酸と炭素数 4 ~ 1 8 の脂肪

族1価アルコールとのエステル、炭素数8~22の高級脂肪族アマイド、シリコーン油、ロジン誘導体などが挙げられる。

[0049]

ブタジエン重合体を化合物(I)と共に加熱溶融するには、例えばブタジエン 重合体ならびに化合物(I)を含むブタジエン重合体組成物を加熱すればよい。

ブタジエン重合体組成物は、ブタジエン重合体および化合物(I)を混合する方法により得ることができる。ブタジエン重合体は、粉末などの固体状態であってもよいし、加熱されて溶融している状態であってもよい。化合物(I)は、例えば粉末などの固体状態のまま混合されてもよいし、加熱されて溶融している状態で混合されてもよいし、溶媒に溶解された溶液として混合されてもよい。ブタジエン重合体が溶融状態で混合すると、ブタジエン重合体に化合物(I)が均一に分散した組成物を得ることができる。かかる組成物における化合物(I)の含有量は、ブタジエン重合体100重量部あたり通常0.001重量部以上、好ましくは0.01重量部以上、さらに好ましくは0.05重量部以上であり、通常10重量部以下、好ましくは5重量部以下である。

[0050]

かかる組成物は、上記した酸化防止剤、添加剤などを含有していてもよく、これらは化合物(I)と共にブタジエン重合体に混合される。

[0051]

ブタジエン重合体組成物を加熱する際の加熱温度は、通常150℃以上、好ましくは170℃以上である。加熱温度の上限はブタジエン重合体および化合物(I)が分解しない温度であればよく、例えば250℃以下、好ましくは220℃ 以下である。

[0052]

かくして加熱溶融したのち、成形する。成形は、射出成形法、押出成形法、ブロー成形法などの通常の方法により成形することができる。

[0053]

かくして成形することにより、ブタジエン重合体成形品を得るが、かかる成形 品は、ゲル化物がなく、外観不良もないので、例えばホース、履物、玩具、フィ ルム、容器などに好適に使用することができる。

[0054]

【発明の効果】

本発明の製造方法によれば、ブタジエン重合体に化合物(I)を含有させているので、ブタジエン重合体が安定化されて、ゲル化物を生ずることなく、ブタジエン重合体成形品を製造することができる。

[0055]

【実施例】

以下、実施例により本発明を拠り詳細に説明するが、本発明はかかる実施例により限定されるものではない。

[0056]

実施例1

スチレンーブタジエンブロック共重合体〔スチレン単位含有量は75重量%、ブタジエン単位含有量は25重量%、淡黄色透明、フィリップス社製、「K-Resin KR-05」〕の粉末100重量部に2,2,5,7,8一ペンタメチルー6-ヒドロキシクロマン(粉末状)0.1重量部を添加した。次いで、30mmφー軸押出機を用いて200℃で約2分間溶融混練しペレット化して、ペレット状のスチレンーブタジエン共重合体組成物を得た。このペレット状の組成物のMFRをメルトインデクサー〔「L246-2531」〕を用いて260℃で荷重2160g、滞留時間15分として測定したところ、29g/10分であった。MFRが大きいほど流動し易いことを示し、ゲル化が進行していないことを示す。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲ ル化物がなく、外観も良好である。

[0057]

実施例2

2, 2, 5, 7, 8 - ペンタメチルー 6 - ヒドロキシクロマンに代えて 2, 2 , 5, 7, 8 - ペンタメチルクロマン (粉末状) 0. 1 重量部を用いる以外は実 施例 1 と同様に操作して、スチレンーブタジエン共重合体組成物を得た。この組 成物のMFRを実施例と同様にして測定したところ、31g/10分であった。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲル化物がなく、外観も良好である。

[0058]

比較例1

2, 2, 5, 7, 8-ペンタメチルー6-ヒドロキシクロマンを用いることなくスチレンーブタジエンブロック共重合体をそのまま溶融混練する以外は実施例1と同様に操作して、スチレンーブタジエンブロック共重合体のペレットを得た。このペレットのMFRを上記メルトインデクサー〔「L246-2531」〕を用いて260℃で荷重2160g、滞留時間15分として測定したところ、4g/10分であり、この値はゲル化が進行していることを示す。

上記で得たペレットを加熱し溶融混練し、射出成形して得られる成形体は、ゲル化物が多く存在し、該ゲル化物に起因して表面に微細な凸部が発生している。

[0059]

以上の結果を表1にまとめて示す。

[0060]

【表1】

		実施例1	実施例2	比較例 1
スチレンープタジエンプロック共重合体 2, 2, 5, 7, 8ーペンタメチルー6ーヒドロキシクロマン 2, 2, 5, 7, 8ーペンタメチルクロマン M F R	(重量部) (重量部) (重量部) /10分)	1 0 0 1 0 0 1 2 9	100 0.1 31	0 0 1 0 0 4

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 ブタジエン重合体を加熱溶融してもゲル化物を生ずることなく加熱溶 融し成形して、ブタジエン重合体成形品を製造し得る方法を提供する。

【解決手段】 ブタジエン重合体を一般式(I)

$$R^{2}$$
 R^{1}
 R^{10}
 R^{9}
 R^{8}
 R^{4}
 R^{5}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{7}

で示される化合物(I)と共に加熱溶融し成形して、ブタジエン重合体成形品を 製造する。ブタジエン重合体としては、例えばポリブタジエン、スチレンーブタ ジエン共重合体、スチレンーブタジエンブロック共重合体、アクリロニトリルー ブタジエン共重合体、アクリロニトリルーブタジエンースチレン共重合体、耐衝 撃ポリスチレンなどが挙げられる。化合物(I)の使用量はブタジエン重合体1 00重量部あたり通常0.001重量部以上である。射出成形法、押出成形法ま たはブロー成形法により成形する。

【選択図】 なし

出願人履歴情報

識別番号

[000002093]

1. 変更年月日 1990年 8月28日

[変更理由] 新規登録 住 所 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

氏 名 住友化学工業株式会社